

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成23年5月19日 (2011.5.19)

【公開番号】特開2011-63850(P2011-63850A)

【公開日】平成23年3月31日 (2011.3.31)

【年通号数】公開・登録公報2011-013

【出願番号】特願2009-215416(P2009-215416)

【国際特許分類】

C 2 3 C 16/18 (2006.01)

H 0 1 L 21/285 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 16/18

H 0 1 L 21/285 C

H 0 1 L 21/28 3 0 1 S

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

【手続補正書】

【提出日】平成23年4月5日 (2011.4.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

基板上に C o 膜を成膜する成膜装置であって、
 基板が収容される処理容器と、
 前記処理容器内で基板を加熱するための加熱機構と、
 前記処理容器外に配置された、成膜原料としてコバルトカルボニルを収容する成膜原料容器と、
 前記成膜原料容器から気体状のコバルトカルボニルを前記処理容器に供給するための配管と、
 前記処理容器内を減圧排気する排気機構と、前記成膜原料容器から前記配管を介して前記処理容器に気体状のコバルトカルボニルを供給するための供給手段と、
 前記成膜原料容器および前記配管の温度をコバルトカルボニルの分解開始温度未満に制御する制御手段と、
 前記成膜原料容器内に C O ガスを供給する C O ガス供給手段と
 を具備することを特徴とする成膜装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記制御手段は、前記成膜原料容器および前記配管の温度を 4 5 未満に制御することを特徴とする請求項 1 に記載の成膜装置。